酸化ガリウム半導体内部への偏光依存ナノ周期構造形成と そのメカニズム解明

Formation mechanisms of polarization-dependent periodic nanostructures in β -Ga₂O₃ semiconductor

 $^{\circ}$ 中西 佑太 1 、下間 靖彦 1 、坂倉 政明 2 、三浦 清貴 1

(1.京大院工、2. 京大産連本部)

Yuta Nakanishi¹, Yasuhiko Shimotsuma¹, Masaaki Sakakura², Kiyotaka Miura¹

(1.Kyoto Univ., 2.SACI, Kyoto Univ.)

E-mail: y.nakanishi@func.mc.kyoto-u.ac.jp

【緒言】近年、我々は赤外フェムト秒レーザーのダブルパルス列を用いてSiおよびGaP結晶の内部構造を直接改質することに成功した。特に間接遷移型半導体の場合においてのみ、偏光依存ナノ周期構造が形成されることを経験的に見出している $^{1,2)}$ 。本研究では、バンドギャップによる影響を確かめるため、間接遷移型半導体との報告がある β - Ga_2O_3 結晶(E_g ~4.8 eV)にフェムト秒レーザーを集光照射し、光誘起される構造変化について評価した。さらに、Snドープ β - Ga_2O_3 結晶についても同様の評価を行った。

【実験】透過波長のフェムト秒レーザーパルス(波長 1240 nm、パルス幅 110fs、繰り返し周波数 1 kHz)をビームスプリッタに通し、一方を時間遅延させた後、再びビームスプリッタを通しダブルパルス列とした。100 倍(NA 0.85)の補正環付き対物レンズを用いて球面収差補正したパルス列を β -Ga₂O₃ 単結晶基板(単斜晶 β -gallia 構造、厚さ 600 μ m)の内部 100 μ m に(010)面に垂直な方向から集光照射した。照射後、偏光顕微鏡で観察後、集光部近傍が表面に露出するまで表面研磨を行い、FE-SEM で観察した。

【結果と考察】Fig. 1 にレーザー集光部の偏光顕微鏡像を示す。Sn ドープされていない試料では集光部中央に複屈折を示す構造が誘起されるのに対し、

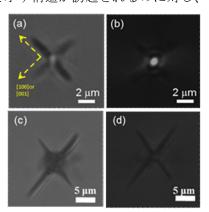
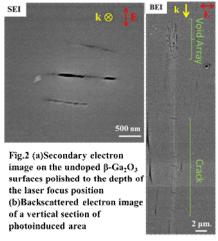


Fig. 1 (a,c) Open-nicol and (b,d) crossnicol images of the photoinduced Structures inside (a,b) undoped β-Ga₂O₃ Or (c,d) Sn-doped β-Ga₂O₃ crystals.

を明らかにするため、研磨後の試料を FE-SEM で観察した(Fig. 2)。二次電子像(SEI)において、偏光方向に対して垂直な方向に配列したナノ周期構造が観測されており、幅 $70\sim80$ nm 程度の空孔が形成されていることがわかった。これまでに間接遷移型半導体(Si、SiC、GaP)内部に光誘起された偏光依存ナノ周期構造は、偏光方向に平行に配列するのに対し、偏光方向に垂直に配列することが知られている4.50。 β -Ga₂O₃内部に形成された構造は誘電材料の場合に類似しており、これはバンドギャップが半導体材

料極くのる英類るえはβに結すのめ、電舞ガ似たた、Snの果るで大起のがスてと表一結て報で大起のがスてと表一結て報はき後振石にい考でプ晶の告



【結言】 -Ga₂O₃内部にフェムト秒レーザーを照射し、偏光方向に対して垂直に配列したナノ周期構造を形成した。 -Ga₂O₃内に形成されるナノ周期構造は、バンドギャップが大きいこと、さらには光誘起プラズマと光との相互作用が偏光方向に垂直なナノ周期構造形成に関与していると考えられる。

【参考文献】

- 1) Phys. Stat. Sol. A 212, 715 (2015).
- 2) J. Appl. Phys. 106, 054307 (2009).
- 3) J. Laser Nano/Microengeneering 11, 1 (2016).
- 4) Phys. Rev. Lett. 91, 247405 (2003).
- 5) Adv. Mater. 22, 36, 4039-4043 (2010).